30 MAR 2065

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



## 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. April 2004 (08.04.2004)

**PCT** 

Deutsch

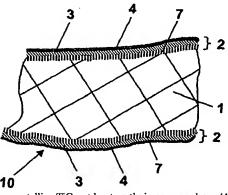
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/029323 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C23C 14/08, 30/00
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH2003/000653
- (22) Internationales Anmeldedatum:
  30. September 2003 (30.09.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache:
- (30) Angaben zur Priorität: 1630/02 30. September 2002 (30.09.2002) CH
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INCOAT GMBH [CH/CH]; Alte Landstrasse 105, CH-8803 Rüschlikon (CH).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MOSER, Eva, Maria [CH/CH]; Quellenweg 9, CH-8224 Löhningen (CH).

- (74) Anwälte: BREITER, Helnz usw.; Breiter + Wiedmer AG, Seuzachstrasse 2, Postfach 366, CH-8413 Neftenbach
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT (Gebrauchsmuster), AT, AU (petty patent), AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ (Gebrauchsmuster), CZ, DE (Gebrauchsmuster), DE, DK (Gebrauchsmuster), DK, DM, DZ, EC, EE (Gebrauchsmuster), EE, EG, ES, FI (Gebrauchsmuster), FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK (Gebrauchsmuster), SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: COMPOSITE MATERIAL
- (54) Bezeichnung: VERBUNDWERKSTOFF



(57) Abstract: A composite material (10) comprises a substrate (1) and a chemically-, mechanically-, physically-, catalytically- and/or opticallyfunctional titanium oxide layer (2), applied on at least one side thereof. A titanium oxide layer (2) is deposited on the substrate (1), as a base layer (3), made from  $TiO_X$  with an oxygen content of  $0.7 \le x < 2$ , or made from  $TiO_X$  (OH), with an oxygen content of  $0.5 \le x < 2$  and a hydroxide content of  $0 \le y < 0.7$  and an upper layer (4) of amorphous and/or crystalline TiO2 applied to said base layer (3). In a first method variation, firstly a base layer (3) of TiO<sub>x</sub> with an oxygen content of  $0.7 \le x < 2$  is reactively or non-reactively deposited, then, through an increase in the oxygen content, the process pressure, the capacity and/or the substrate temperature, an upper layer (4) of amorphous and/or crystalline TiO2 is deposited. In a second method variation, firstly a base layer (3) of TiOx with an oxygen content of  $0.7 \le x < 2$  is reactively or non-reactively deposited and then post-oxidised on the surface by means of an electrochemical, thermal and/or plasma process, until the base layer (3) is converted into amorphous

or crystalline TiO2, at least partly in an upper layer (4).

(57) Zusammenfassung: Ein Verbundwerkstoff (10) besteht aus einem Substrat (1) und einer wenigstens einseitig aufgebrachten chemisch, mechanisch, physikalisch, katalytisch und/oder optisch funktionalen Titanoxidschicht (2). Auf dem Substrat (1) ist eine Titanoxidschicht (2) aus einer Grundschicht (3) aus  $TiO_X$  mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.7 \le x < 2$  oder aus  $TiO_X$  (OH), mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.5 \le x < 2$  und einem Hydroxidgehalt von  $0 \le y < 0.7$  und auf dieser Grundschicht (3) eine Oberschicht (4) aus amorphem und/oder kristallinem  $TiO_2$  aufgebracht. Nach einer ersten Verfahrensvariante wird vorerst reaktiv oder nicht reaktiv eine Grundschicht (3) auf  $TiO_X$  mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.7 \le x < 2$ , dann durch Erhöhen des Sauerstoffgehalts, des Prozessdrucks, der Leistung und/oder der Substrattemperatur, eine Oberschicht (4) aus amorphem und/oder kristallinem  $TiO_2$  abgeschieden. Nach einer zweiten Verfahrensvariante wird vorerst reaktiv oder nicht reaktiv eine Grundschicht (3) aus  $TiO_X$  mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.7 \le x < 2$  abgeschieden und anschliessend elektrochemisch, thermisch und/oder mit einem Plasmaprozess an der Oberfläche postoxidiert, bis die Grundschicht (3) wenigstens teilweise in eine Oberschicht (4) aus amorphem oder kristallinem  $TiO_2$  umstrukturiert ist.